自然数の積空間における C*-埋込された 離散部分集合の濃度の決定不可能性

神奈川大学 工学部

平田 康史 (Yasushi Hirata) 矢島 幸信 (Yukinobu Yajima) Faculty of Engineering, Kanagawa University

1 はじめに

ここでは,すべての位相空間は T_1 であり,すべての濃度 κ や τ は無限とする。空間Xに対して,その部分集合AがXにおいて C^* -埋込される(C-埋込される)とは,Aから閉区間 [0,1](実数全体 \mathbb{R}) への任意の連続関数が,連続的にX全体に拡張できるとき。

次の古典的な定理はよく知られている。

定理 1.1 (Tieze-Urysohn の拡張定理, 1925). 空間 X 対して, 次は同値である。

- (a) *X* は正規である。
- (b) X の任意の閉集合は、X において C^* -埋込できる。
- (c) X の任意の閉集合は、X において C-埋込できる。

自然数全体の集合 $\mathbb{N}=\{1,2,\cdots\}$ に離散位相を導入して, \mathbb{N} を無限可算離散空間とみなす。 \mathbb{N}^{κ} は \mathbb{N} の κ 個のコピーによる積空間を表す。

また古典的な結果として,次を思い出す。

定理 1.2 (Stone, 1948). \mathbb{N}^{ω_1} は正規でない。

定理 1.1 と 1.2 により,次の問題が自然に生じる。

問題 $1. N^{\omega_1}$ において C^* -埋込された閉集合は、 N^{ω_1} において C-埋込されるか?

この問題に対して、2014年に次の否定的結果が得られていた。これは連続体仮説のもとで、問題1が否定されることを意味する。

定理 1.3 (E. Pol-R. Pol [3]). N において C^* -埋込されるが C-埋込されない可算離散閉集合が存在する。

ところがつい最近, 我々[2] は次の結果を証明した。

定理 1.4. マーチンの公理と連続体仮説の否定のもとで、 \mathbb{N}^{ω_1} における任意の C^* - 埋込された部分集合は、 \mathbb{N}^{ω_1} において C-埋込される。

これら2つの結果は、問題1の解答として次の全く予想外の結果を生じる。

 \mathbf{A} 1.5. \mathbb{N}^{ω_1} において C^* -埋込された(閉)集合が, \mathbb{N}^{ω_1} において C-埋込されるかどうかは, \mathbb{E} の公理系の中では決定できない。

そうすると上記の定理 1.3 のあたりに、もう一つ別の予想外の結果があるのではないかと考えたくなる。そこで思い出すのが、1990 年と比較的古い次の結果である。

定理 1.6 (Baturov [1]). 濃度 τ に対して、 $2^{\tau} \le \mathfrak{c}$ が成り立つための必要十分条件は、 $\mathbb{N}^{\mathfrak{c}}$ において濃度 τ の離散閉集合を含む稠密な正規部分空間が存在することである。

マーチンの公理と連続体仮説の否定のもとでは, $2^{\omega_1}=\mathfrak{c}$ が成り立つこと及び正規性が C^* -埋込で特性化できることに着目して,定理 1.3 と 1.6 から次の問題が自然に生じてくる。

問題 $2. \mathbb{N}$ において C^* -埋込された非可算な離散部分集合は存在するか?

2 問題2の解答

問題2に関して、我々は次の結果を主定理として証明した。

定理 2.3. 濃度 κ が $\kappa^{\omega} = \kappa$ であるとする。このとき,任意の(Ulam 非可測)濃度 τ に対して,次は同値である。

- (a) 不等式 $2^{\tau} \leq \kappa$ が成り立つ。
- (b) \mathbb{N}^{κ} において \mathbb{C}^* -埋込された濃度 τ の離散部分集合が存在する。
- (c) \mathbb{N}^{κ} において C-埋込された濃度 τ の離散部分集合(閉集合)が存在する。

 $\kappa = \mathfrak{c}$ とおくと $\mathfrak{c}^{\omega} = \mathfrak{c}$ を満たし, $\tau = \omega_1$ は Ulam 非可測だから,次は定理 2.1 の直接の結果である。

系 2.4. 次は同値である。

- (a) 不等式 $2^{\omega_1} \leq \mathfrak{c}$ が成り立つ。
- (b) $\mathbb{N}^{\mathfrak{c}}$ において \mathbb{C}^* -埋込された非可算離散部分集合が存在する。
- (c) \mathbb{N}^r において C-埋込された非可算離散閉集合が存在する。

連続体仮説を仮定すると、 $\omega_1=\mathfrak{c}<2^\mathfrak{c}=2^{\omega_1}$ となり、系 2.4(a) の不等式は満たされない。従って、次を得る。

系 2.5. 連続体仮説のもとで、 \mathbb{N}^{c} において任意の \mathbb{C}^{*} -埋込された離散部分集合は可算である。

系2.4と2.5から、問題2の解答も系1.5と同様に、次の予想外の結果となった。

系 2.6. N° における C^* -埋込された非可算な離散部分集合が存在するかどうかは、 ZFC の公理系の中では決定できない。

3 \mathbb{N}^{κ} における濃度 κ の C^* -埋込された離散部分集合

任意の濃度 κ に対して、 $2^{\kappa} > \kappa$ であるから、 $\tau = \kappa$ のとき定理 2.3 のおける不等式は成り立たない。従って、次の問題は否定的に解決されるように思える。

問題 $\mathbf{3.}$ κ を非可算濃度とするとき, \mathbb{N}^{κ} において C^* -埋込された濃度 κ の離散部分集合は存在するか?

濃度 κ に対して、 $cf(\kappa)$ は κ の共終数を表すとして、予想通りに次を得る。

定理 3.1. 濃度 κ が $cf(\kappa) > \omega$ であるとする。このとき, \mathbb{N}^{κ} において C^* -埋込された濃度 κ の離散部分集合は存在しない。

ところが一方では、そうでない濃度 κ に対しては、逆の結果が得られる。

命題 3.2. 一般連続体仮説のもとで、濃度 κ が $\mathrm{cf}(\kappa) = \omega$ であるとする。このとき、 \mathbb{N}^{κ} において C-埋込された濃度 κ の離散部分集合が存在する。

以上によって、問題3の解答は κ の取り方に依存することがわかる。

4 未解決問題

2 点からなる離散空間 $\{0,1\}$ の κ 個のコピーによる積空間を $\{0,1\}^{\kappa}$ で表す。 \mathbb{N}^{κ} の代わりに $\{0,1\}^{\kappa}$ を置き換えると,次を得ることができる。

命題 4.1. 任意の 2 つの濃度 κ と τ に対して,不等式 $2^{\tau} \le \kappa$ が成り立つための必要十分条件は, $\{0,1\}^{\kappa}$ における C^* -埋込された濃度 τ の離散部分集合が存在することである。

上記の命題からも上の定理 2.3 において,濃度 κ の条件「 $\kappa^{\omega} = \kappa$ 」は極めて目障りである。実際,この条件は定理 2.3 の $(b) \rightarrow (a)$ の証明にのみ用いられている。従って,次の問題が自然に提起される。

問題 4. 濃度 κ は $\kappa^{\omega} > \kappa$ であるとする。もし \mathbb{N}^{κ} において C^* -埋込された濃度 τ の離散部分集合(または C-埋込された濃度 τ の離散閉集合)が存在するならば,不等式 $2^{\tau} \leq \kappa$ は成り立つか?

注意. 仮定 $2^{\omega}=2^{\omega_1}=\omega_3$ のもとで, \mathbb{N}^{ω_2} において C^* -埋込された非可算な離散部分集合が存在することが証明できれば,問題 4 は否定的に解決される。

参考文献

- D. P. Baturov, Normality in dense subspaces of products, Topology and Appl. 36 (1990), 111–116.
- [2] Y. Hirata and Y. Yajima, Undecidability of the existence of C*-embedded but not C-embedded subsets in a product of natural numbers, preprint.
- [3] E. Pol and R. Pol, Note on countable closed discrete sets in products of natural numbers, Topology and Appl. 175 (2014), 65–71.